

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公表番号】特表2009-530138(P2009-530138A)

【公表日】平成21年8月27日(2009.8.27)

【年通号数】公開・登録公報2009-034

【出願番号】特願2009-500734(P2009-500734)

【国際特許分類】

B 2 9 C 51/00 (2006.01)

C 0 8 L 69/00 (2006.01)

C 0 8 L 83/04 (2006.01)

C 0 8 K 3/34 (2006.01)

C 0 8 K 3/38 (2006.01)

E 0 6 B 5/16 (2006.01)

C 0 8 L 51/04 (2006.01)

C 0 8 J 5/00 (2006.01)

【 F I 】

B 2 9 C 51/00

C 0 8 L 69/00

C 0 8 L 83/04

C 0 8 K 3/34

C 0 8 K 3/38

E 0 6 B 5/16

C 0 8 L 51/04

C 0 8 J 5/00 C F D

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月3日(2010.3.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

( i ) 以下の成分

A ) 分枝芳香族ポリカーボネートおよび / または分枝芳香族ポリエステルカーボネート、 40 ~ 95 重量部、

B ) シリコンゴムおよびシリコン - アクリレートゴムを包含する群から選択される一種類以上のグラフトベースを含むグラフトポリマー、 1 ~ 25 重量部、

C ) タルク、 9 ~ 18 重量部、

D ) リン含有防炎加工剤、 0 . 4 ~ 20 重量部、

E ) 一種類以上の無機ホウ素化合物、 0 . 5 ~ 20 重量部、および

F ) ドリップ防止剤、 0 ~ 3 重量部

を含む組成物を溶融し、混合し、

( i i ) 生じる溶融物を冷却し、粒状化し、

( i i i ) 粒状物を溶融し、シートに押し出し、かつ

( i v ) シートを三次元物体に成形する、

熱成形物品の製造方法。

## 【請求項 2】

工程 ( i v ) においてシートを外力の影響下において熱成形、圧伸成形、深絞り成形または真空成形によって三次元物体に成形する、請求項 1 に記載の方法。

## 【請求項 3】

請求項 1 または 2 による方法によって得られる熱成形物品。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0019】

熱可塑性芳香族分枝ポリカーボネートの製造に好適な連鎖停止剤は、例えばフェノール、p-クロロフェノール、p-tert-ブチルフェノールまたは2,4,6-トリプロモフェノール、並びに長鎖アルキルフェノール、例えばDE-A 2 842 005による4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノールまたはアルキル置換基中に全部で8~20個の炭素原子を有するモノアルキルフェノールもしくはジアルキルフェノール、例えば3,5-ジ-tert-ブチルフェノール、p-イソ-オクチルフェノール、p-tert-オクチルフェノール、p-ドデシルフェノールおよび2-(3,5-ジメチルヘブチル)フェノールおよび4-(3,5-ジメチルヘブチル)フェノールである。使用される連鎖停止剤の量は、一般的に、特定の場合に使用されるジフェノールのモルの合計に対して、0.5mol.%~10mol.%である。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0071】

式(VIII)におけるXは、好ましくは炭素原子を6~30個有する単環または多環芳香族残基である。この残基は、好ましくは式(I)のジフェノールから誘導されている。

## 【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0072】

式(VIII)中のnは、互いに独立して、0または1であり、好ましくは1である。

## 【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0095

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0095】

好ましいポリアルキレンテレフタレートは、テレフタル酸残基、ジカルボン酸成分に対して少なくとも80wt.%、好ましくは少なくとも90wt.%およびエチレングリコール残基および/またはブタン-1,4-ジオール残基、ジオール成分に対して少なくとも80wt.%、好ましくは少なくとも90wt.%を含む。